

Chapter 1

東京エレクトロンについて

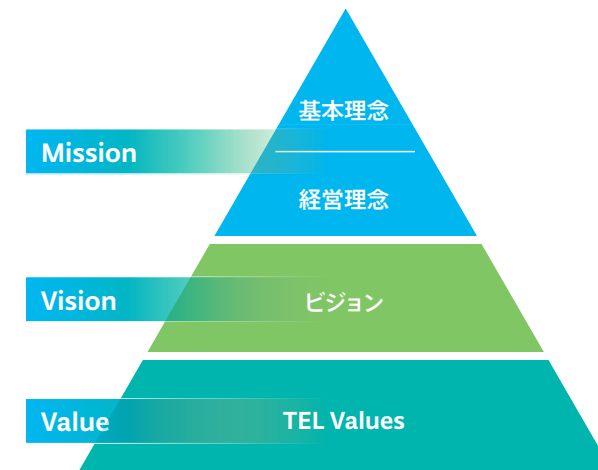
- 4 企業理念体系
- 5 CEOメッセージ
- 9 会社概要
- 10 半導体製造プロセスおよび当社の主要製品
- 11 継続的な企業価値の向上に関する重要指標ハイライト



当社は、半導体製造装置メーカーとして、半導体産業の発展に貢献し、成長を続けてきました。半導体製造の主要プロセスにおいて革新的な技術をもつBest Productsと付加価値の高いBest Technical Serviceを提供することにより、基本理念を实践し、真のグローバルエクセレントカンパニーを目指します。

企業理念体系

東京エレクトロンの企業理念体系は、1963年の創業当時より今日に至る成長の中で、常に基本としてきた経営の考え方をまとめたものです。中長期的な視点から、企業としての使命とその実現に向けて大切にする価値観や具体的な行動のあり方などを表し、Mission、Vision、Valueで構成されています。



Mission

基本理念 当社の存在意義 (Purpose) や社会的使命

最先端の技術と確かなサービスで、夢のある社会の発展に貢献します

経営理念 大切にすべき経営の規範

利益について

社会や産業の発展に貢献すべく、利益の追求を重視し企業価値の向上を目指します。

社員について

社員は価値創出の源泉であり、創造性と責任感と強いチームワークで情熱をもって業務に取り組みます。

事業分野について

エレクトロニクスを中心とする最先端技術分野において、高品質な製品を提供し市場をリードします。

組織について

個々の能力を最大限に発揮し、企業価値を最大化する最適な組織を築きます。

成長について

技術革新に常に挑戦し、事業拡大と市場創出により継続的な成長を図ります。

安全と健康と環境について

事業に関わるすべての人々の安全と健康、および地球環境への配慮を第一に考えて行動します。

品質とサービスについて

顧客の満足と信頼を得るために真のニーズを理解し、品質とサービスの向上に努めます。

企業の社会的責任について

企業としての社会的責任を自覚し、社会から高く評価され社員が誇りを持てる企業であるよう心がけます。

Vision

ビジョン 基本理念と経営理念に基づき中長期的に実現したい事業像

半導体の技術革新に貢献する夢と活力のある会社

東京エレクトロンは、世の中の持続的な発展を支える半導体の技術革新を追求します。

当社の専門性を生かし、付加価値の高い最先端の装置と技術サービスを継続的に創出することで、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を目指していきます。

そして、企業の成長は人、社員は価値創出の源泉と位置づけ、ステークホルダーとのエンゲージメントを通じて、このビジョンの実現に向けて活動してまいります。

Value

TEL Values 社員一人ひとりが遵守すべき心構えや行動規範、価値観

誇り

私たちは、自らが誇りをもてる高い価値をもった製品・サービスを提供します。

オーナーシップ

私たちは、オーナーシップをもって、考え抜き、やり抜き、やり遂げます。

自覚

私たちは、社会の一員としての自覚をもち、責任のある行動をします。

チャレンジ

私たちは、世界No.1を目指し、新しいこと、人のやらないことにチャレンジします。

チームワーク

私たちは、お互いを認め合い、チームワークを大切にします。



TEL Valuesは、私たちが積み上げてきたものであり、これからも自分たちの手によって積み上げていくものです。

CEOメッセージ



代表取締役社長・CEO

河合 利樹

ステークホルダーの皆さまには、平素よりご支援とご愛顧を賜り、心から感謝申し上げます。

東京エレクトロンは1963年の創立以来、事業環境の変化に素早く対応しながら、時代をリードする独創的な技術で半導体産業の発展に貢献し、成長してまいりました。今日の東京エレクトロンがあるのも、ひとえに皆さまのご支援のおかげでございます。当社は、「最先端の技術と確かなサービスで、夢のある社会の発展に貢献します」という基本理念の実践を通じ、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上に取り組んでおります。

半導体の過去・現在・未来

1947年のトランジスタの誕生以来、半導体の技術革新が、ICT産業の成長を力強く牽引してきました。PCやスマートフォンなどのデジタル機器が普及し、誰もがインターネットやプラットフォームサービスを使用するようになりました。こうしたサービスを通じて蓄積された膨大なデータを駆使してAIが新たな価値をつくり出す時代になっています。さらに、近年の生成AIの登場を機に、AIの利活用は日増しに拡大しており、デジタル技術と、私たちの暮らしやあらゆる産業との関係は、これまでにないほど密接になっています。

AIの進化、それに伴う社会の変容は産業革命の文脈で語られることも多いですが、これまでの産業革命では「筋力」が機械化・自動化されてきたのに対し、AIは「知的労働」や「考える部分」を自動化していきます。AIの性能は数年前と比べてすでに隔世の感がありますが、これからはエージェント型AIやフィジカルAIの登場に伴い、さらなる進化が期待されます。また、従来のビット・コンピューティングに加えて、量子コンピューティングやニューロモルフィック・コンピューティングを融合した新たなコンピューティング時代の到来、それを支える6Gや7Gのような次世代通信規格などの技術革新が、私たちの暮らしをより良い方向へ変革する可能性を秘めています。

「デジタル×グリーン」と半導体の技術革新

しかし、そのような未来の実現に向けて、克服しなければならない課題もあります。消費電力の問題です。AIの普及に伴い、AIデータセンターの需要が急速に増加しています。従来のデータセンターは、大量のデータ保管や、ウェブサイトの安定稼働を目的としたものがメインでしたが、AIデータセンターは超・大規模なコンピューティング（計算処理）に特化しています。IEA（International Energy Agency）のレポートによると、AIデータセンターの普及に伴い、2030年には現在と比べてデータセンターの電力消費が約130%増加すると予測されています。また、CO₂排出量についても、80%増えるおそれがあります。

この試算では、データセンターの電力需要増加分の約半分を再生可能エネルギーで賄うことが見込まれていますが、それでもCO₂排出量は現在の2倍近くになるという予測です。データセンターは、今や社会を支える重要なインフラですが、環境負荷を軽視してよい訳ではありません。AIがより便利になるような、演算の超高速化やデータ転送の広帯域化などの性能向上の追求が重要であるとともに、地球温暖化への対策が一層求められています。こうした中、社会のデジタル化と地球環境保全に向けた脱炭素化、すなわち「デジタル×グリーン」が世界の潮流であり、共有価値となっています。

この「デジタル×グリーン」の実現に欠かせないのが半導体の技術革新です。半導体には、さらなる高速化、大容量化、高信頼化、低消費電力化の、4つの進化の方向性があります。そして、これを実現するための半導体製造には2つのアプローチがあります。1つは、半導体の進

CEOメッセージ

化の代名詞でもあるスケーリング（微細化）で、チップ上での半導体の集積度を高めていきます。もう一つはさまざまな機能を集積化する、アドバンストパッケージングです。AI半導体もこのスケーリングとアドバンストパッケージングを駆使してつくられているものであり、これを支える半導体製造装置の役割は年々重要性が増しているとともに、市場の拡大が期待できます。

東京エレクトロンのビジョンと強みを活かした経営

東京エレクトロンは、そうした半導体をつくるための装置を製造・販売する会社で、世界における半導体製造装置のリーディングサプライヤーの1つです。

当社のビジョンは、「半導体の技術革新に貢献する夢と活力のある会社」です。このビジョンは、「TSV (TEL's Shared Value)^{※1}」の考え方に基づいています。半導体製造装置メーカーとしての専門性を生かし、付加価値の高い最先端の装置と技術サービスを継続的に創出することで、「デジタル×グリーン」を支える半導体の技術革新に貢献します。また、利益は製品とサービスの価値の大きさを示す尺度と考え、ワールドクラスの利益を追求します。その利益を次なる成長投資につなげることで、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を目指していきます。そして、「企業の成長は人。社員は価値創出の源泉」と位置づけ、すべてのステークホルダーとのエンゲージメントを通じて、このビジョンの実現に向けて活動してまいります。

当社の最大の特徴は、半導体製造における最先端領域を得意としていることです。微細なトランジスタを形成する前工程から、先端パッケージングにわたる幅広い工程に対応できる装置群を有しており、その多くが世界シェア上位を獲得しています。AI向けロジックデバイスをはじめとした最先端の半導体を製造するための工程数は2,000以上に上りますが、当社の強みである業界最大の装置出荷実績（累計100,000台以上）および業界最大の特許保有数（約27,000件）に基づく幅広い製品ラインアップを軸に、付加価値の高い「Next-generation products」のタイムリーかつ継続的な創出に取り組んでいます。

また、製造現場に変革をもたらす「Manufacturing DX^{※2} with AI & Robotics」構想のもと、装置とフィールドサービスの二軸に対する生産性向上をAIとロボットを駆使して実現するソリューション「Epsira™（イプシラ）」を昨年12月にリリースしました。すでに、一部のサービ

スについては、主要なお客さまの量産現場への提供も開始しており、今後も、お客さまの生産性向上に貢献する取り組みを加速させていきます。

そして、お客さまの課題を解決し、半導体の絶え間ない技術革新に貢献し続けるソリューション・プロバイダとして、世の中の半導体製造に不可欠な比類なき存在になることを目指してまいります。

※1 TSVは、CSV (Creating Shared Value) の考え方を当社グループの事業に即して捉えなおしたものの。

CSVは、企業の専門性を活用して社会課題を解決することで、社会的価値と経済的価値を創出し、企業価値の向上と持続的な成長を実現するという考え方

※2 DX: Digital Transformation



中期経営計画の進捗

ビジョンの実現に向けた中期経営計画として、当社は2027年3月期までに売上高3兆円以上、営業利益率35%以上、ROE 30%以上を目指す財務目標を設定しております。

当社の業績は、この10年で売上高は4倍、営業利益は7倍に成長してきました。加えて、足元ではAIサーバー向け半導体の旺盛な需要から、先端デバイス向け投資に関して強い引き合いをいただいております。売上高については3兆円以上の達成が見えてきております。ROEに関しましても、純利益の増加と資本効率の向上により、30%以上の達成が見込める状況です。一方、当社を取り巻く事業環境は、以前に増して大きく変化しています。米中対立に伴う規制や関税、中東紛争やロシア・ウクライナ戦争の長期化などの地政学的な影響、世界的なインフレや為替変動、お客さまの投資計画の変更など、さまざまな事業環境の変化が起きている。このため、営業利益率の目標達成に向けてはチャレンジングな状況となっています。

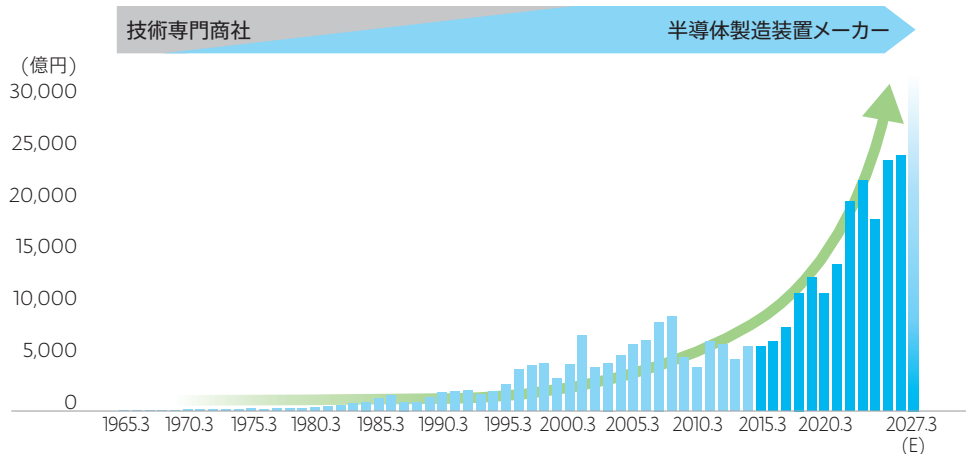
このような事業環境の中、稼ぐ力を究明・追求し、時代の変化に適切に対応していくことが重要です。これまでの着実な進捗により、1兆円の営業利益が視野に入ってきましたが、利

CEOメッセージ

益率のさらなる向上を図るため、以下の5つのポイント、すなわち、①付加価値の高い次世代装置（強い“Next-generation products”）の継続的な提供、②納入した装置のアップグレード、③AIやロボティクスを活用したアドバンスド・フィールドソリューションの展開、④装置の立ち上げ期間を半分にする「One-touchスタートアップ」による効率性の追求、⑤インフレに伴うコスト増に対する適切な価格改定、について重点的に取り組んでまいります。

当社は、強みをさらに磨き、将来の成長機会を最大限に取り込むべく、2025年3月期からの5年間で研究開発投資1.5兆円以上、設備投資7,000億円以上、人材採用はグローバルで10,000名とする成長投資計画を設定し、取り組みを進めております。成長事業への投資と既存事業の効率化を通じて、継続的にワールドクラスの利益率を目指すとともに、資本効率の観点ではROE 30%以上を意識しながら適切なキャピタルアロケーションを実施していきます。

連結売上高



人材に関する取り組み

当社では、「企業の成長は人。社員は価値創出の源泉」と考えます。社員がそれぞれの能力を最大限に発揮できるよう、社員の意欲とエンゲージメントを高めることがCEOとしての私の重要なミッションの1つであると捉え、次の5つのポイントからなる「やる気重視経営」に取り組んでいます。

やる気重視経営の5つのポイント

1. 自分の会社や仕事が産業や社会の発展に貢献しているという実感をもてること

- TEL's Shared Value:
デジタル化と地球環境保全に向けた脱炭素化を支える半導体の技術革新に貢献
- E-COMPASSの活動を通じ、2040年までにネットゼロの達成を目指す

2. 会社の将来に対する夢と期待がもてること

- 将来の成長が強く見込まれる半導体製造装置業界でビジネスを展開
- 高い財務目標（売上高3兆円以上、営業利益率35%以上、ROE 30%以上）、ワールドクラスの利益率の達成をグループ全体で追求

3. チャレンジできる機会があること

- 積極的な研究開発投資をはじめとした成長投資の実施
(2025年3月期からの5年間で研究開発投資1.5兆円以上、設備投資7,000億円以上、人材採用はグローバルで10,000名とする成長投資計画)

4. 成果に対する公正な評価とグローバルに競争力のある報酬

- 業績連動報酬制度の採用

5. 風通しの良い職場であること

- 社員集会や座談会をはじめとした社員と経営トップとのコミュニケーションの定期的な実施（3年間で国内外26拠点で実施）

また、人材多様性が重要であるという認識のもと、Global、Gender、Generationの3Gの観点を意識しながら、ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンを推進しております。そして、さまざまなキャリアパスを示した上で教育プログラムの充実化も図り、社員の成長を支えております。

さらに当社は、業界のリーディングカンパニーとして、将来の半導体産業を担う学生や研究者などの育成もミッションと捉え、積極的に取り組んでおります。日米の大学によって構成される「半導体の人材育成と研究開発に関する未来に向けた日米大学間パートナーシップ (UPWARDS※3)」に参画するなど、さまざまな産学連携プログラムの支援を通じ、次世代の半導体人材の育成に寄与することで、半導体産業のサステナブルな発展に貢献してまいります。

※3 UPWARDS: U.S.-Japan University Partnership for Workforce Advancement and Research & Development in Semiconductors

CEOメッセージ

環境に関する取り組み

社会において地球環境保全の重要性がより一層高まる中、当社では、持続可能な社会の実現に貢献すべく、あらゆる事業活動を通じて環境負荷低減、とりわけ脱炭素化に取り組んでいます。2040年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにする「ネットゼロ」目標を設定しており、お客さまが当社グループの製品を使用する際のCO₂排出量の削減、木材梱包の削減やモーダルシフトの推進による物流での環境負荷低減、各事業所における再生可能エネルギー使用の推進と資源使用量の削減などの取り組みを進めています。

また、当社内のみならず、お客さまやパートナー企業さまと連携しながら、製品のライフサイクル※4全体について環境負荷低減を進めております。その一環として、環境にフォーカスしたイニシアティブ「E-COMPASS※5」を推進しており、サプライチェーン全体で半導体の技術革新と環境負荷低減に取り組んでおります。

※4 製品のライフサイクル: 製品の企画・開発・設計から、調達、製造、物流、お客さまにおける使用時、メンテナンス・サービス、廃棄のバリューチェーン

※5 E-COMPASS: Environmental Co-Creation by Material, Process and Subcomponent Solutions

“攻め”と“攻め”のガバナンス

当社では、短期および中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を目指し、「“攻め”と“攻め”のガバナンス」を基本姿勢として経営をおこなっております。1つ目の“攻め”は、「“攻め”の事業活動」です。「利益は製品とサービスの価値の大きさを示す尺度」であると捉え、革新的な技術をもつBest Productsと付加価値の高いBest Technical Serviceの提供により、常にワールドクラスの営業利益率と30%以上のROEを追求していきます。

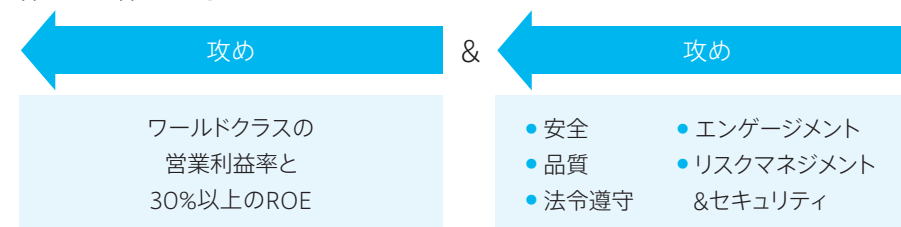
2つ目の“攻め”は、「“攻め”の経営基盤構築」です。すべての企業活動の基本である、安全・品質・法令遵守や社員をはじめとするステークホルダーとのエンゲージメント、セキュリティの強化・向上などについても、当社の強みとすべく追求していきます。特に、「Safety First」を重視しており、労働時間20万時間当たりの人身事故発生率を示す「TCIR※6」で職場環境の安全性をモニタリングしています。2026年3月期のTCIRは0.22と、半導体製造装置業界の中でトップクラスを実現しております。当社製品の仕様に关わる安全性はかなり高い

レベルで確保できているので、人的要因や行動要因による事故をもう一段減らしていくために、全社を挙げての安全キャンペーンをおこなうなど、取り組みを進めています。

また、「企業の成長は人。社員は価値創出の源泉」であり、社員が長く働きたいと思える会社づくりをしていきたいと考えています。当社の離職率は、日本では0.9%、グローバルで見ても2.2%と、半導体製造装置業界の中でも特筆すべき低さを誇っています。半導体人材の不足が叫ばれる中、人的資本経営の観点から、中長期的視点で人材の開発・活用に取り組めることは大きな強みになると考えております。

※6 TCIR: Total Case Incident Rate

“攻め”と“攻め”のガバナンス



皆さまに愛され信頼される企業を目指して

半導体が実現する豊かな未来、進化し続ける半導体。それを支える製造装置市場は新たな成長フェーズに入りました。東京エレクトロンは世界No. 1を目指して、これからも挑戦と進化を続け、当社だからできる付加価値の高い世の中になく技術を創造し、社会に提供してまいります。そして、「デジタル×グリーン」の実現に貢献し、半導体産業になくはならないソリューション・プロバイダかつ、地球に選ばれる真のグローバルエクセレントカンパニーへと進化を遂げるとともに、すべてのステークホルダーに愛され、高く信頼され、夢と活力のある会社であり続けられるよう努めてまいります。

引き続き、皆さまのご支援を賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長・CEO

利樹

会社概要

当社は、半導体製造装置業界におけるリーディングカンパニーとしてグローバルに事業を展開しています。Best Products、Best Technical Serviceにより、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上に努めています。事業を通じてサステナブルな社会の構築と発展に貢献することで、基本理念を実践していきます。

拠点数

(2026年4月1日現在)

海外
20社
17の国と地域
72拠点

国内
6社
30拠点

合計(連結)
26社[※]
18の国と地域
102拠点

■ 本社 ■ 支社、事業所(サービス拠点を含む)、営業所

※ 現在清算整理中の会社は地図上に表記していません

沿革

1963

(株)東京放送の出資により
(株)東京エレクトロン研究所を設立



1964

米国サムコ社から拡散炉の輸入販売代理権を獲得し、販売を開始



1968

テル・サムコ(株)で拡散炉の国内生産を開始



1978

(株)東京エレクトロン研究所から東京エレクトロン(株)へ商号変更

1980

東京証券取引所市場第二部に上場



1984

東京証券取引所市場第一部に指定替え



1986

半導体製造装置の輸出を開始

1990s

サービスや製造を担う会社の設立など国内グループ体制を強化、事業のグローバル化を推進するため世界各国に現地法人を設立

1990

フラットパネルディスプレイ製造装置市場へ本格参入

1994

海外での直接販売・サポート体制を開始

1999

東京証券取引所市場第一部における業種変更「商業」から「電気機器」へ

2006

行動規範として「TEL Values」制定

2007

人材開発強化のため「TEL UNIVERSITY」設立



2015

東京エレクトロン コーポレートガバナンス・ガイドラインを制定

新生TELとして再出発(ビジョン、中期経営計画の策定、コーポレートロゴ刷新)

2021

統合報告書の発行を開始

2022

東京証券取引所プライム市場に指定替え



新たなビジョンと中期経営計画を策定
コーポレートメッセージとして Technology Enabling Lifeを制定

Technology Enabling Life

2023

創立60周年

売上高
2兆4,435億円

2026年3月期

(億円)
25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

1960s ~

技術専門商社として創業

1980s ~

本格的にメーカーへ移行

1990s ~

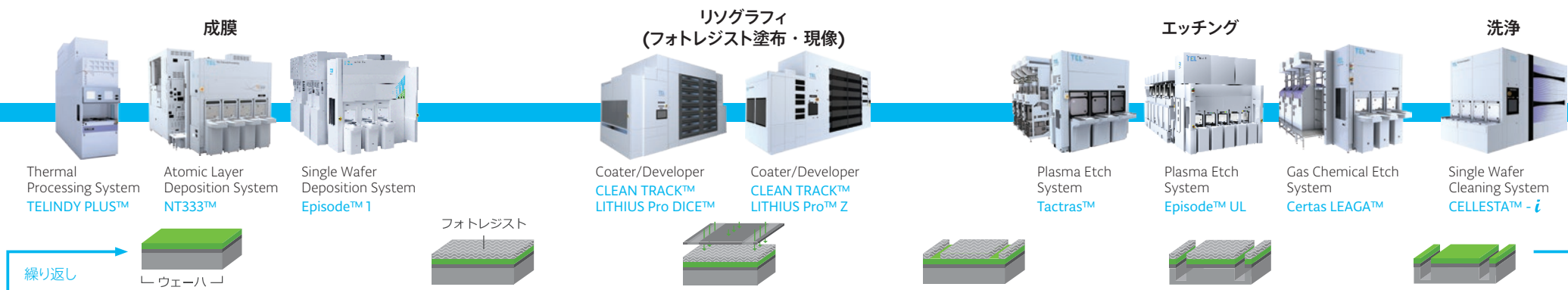
グローバル化を加速

2000s ~

イノベーションと成長を志向

半導体製造プロセスおよび当社の主要製品

■ ウェーハ処理プロセス (前工程) ■ 検査・組み立てプロセス (後工程)



膜形成

酸化、CVD※1、あるいはALD※2法などを用いて、清浄なウェーハ上に薄膜（シリコン酸化膜、シリコン窒化膜、金属など）を堆積、成膜します。

※1 CVD: Chemical Vapor Deposition (化学気相成長)
※2 ALD: Atomic Layer Deposition (原子層堆積)

フォトレジスト※3塗布

ウェーハを高速回転させながら、フォトレジストをウェーハ全面に薄く、均一に塗布します。

※3 フォトレジスト: UV光により性質変化が起こる感光材料

露光

ICパターンを描いたフォトマスクをウェーハに合わせ、露光装置でUV光を照射し、フォトレジストにパターンを転写します。

現像

露光されたフォトレジストを現像液で溶かします。これにより、使用したフォトマスクに応じたパターンがウェーハ上に残ります。

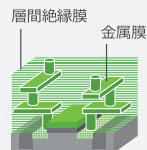
エッチング

プラズマエッチング装置やプラズマレスのガスケミカルエッチング装置で、リソグラフィで形成されたパターンに従って、シリコン酸化膜・シリコン窒化膜・シリコンなどを所望の形状に削ります。

レジスト除去・洗浄

エッチング後に不要になったフォトレジストを除去します。また、洗浄装置でウェーハを薬液に浸して、不純物を除去します。

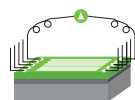
貼り合わせ



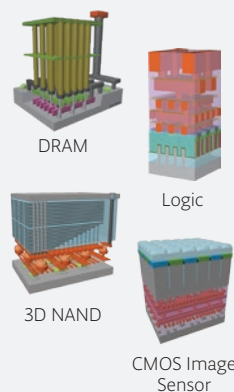
トランジスタ
(素子)と
配線が完成

トランジスタと配線がつくりこまれた複数枚のウェーハを貼り合わせる場合もあります。この貼り合わせにより1つの集積回路に統合します。

ウェーハ検査



形成された集積回路の1つひとつに対し、良・不良判定をおこないます。



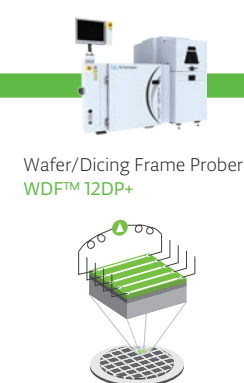
集積回路の完成

貼り合わせ・剥離

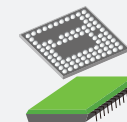


再配線層や接合パッド（バンパ）を形成後、ウェーハを支持基板に貼り合わせ、裏面を薄化する場合もあります。その後、支持基板をデボンディング装置により剥離します。

検査



ウェーハから切り出されたチップ1つひとつに対し、良・不良判定をおこないます。



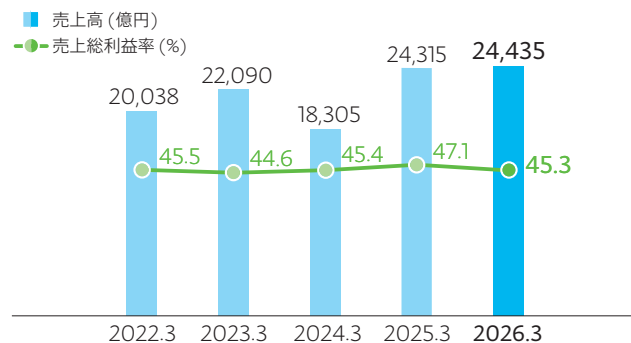
良品チップをパッケージ基板、リードフレームなどに実装し、さまざまな材料で封止します。

半導体
パッケージングの
完成

継続的な企業価値の向上に関する重要指標ハイライト

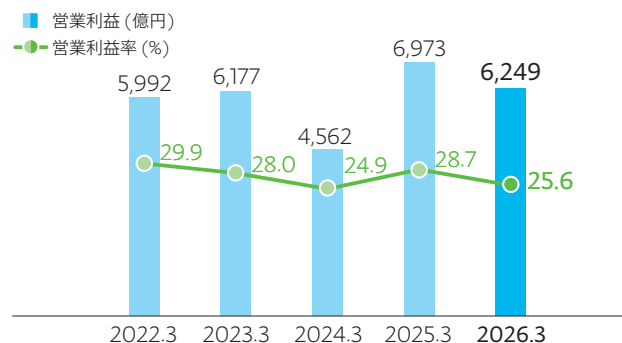
当社では、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上において重要である経営上の指標を明確にし、モニタリングや分析を実施することにより、事業活動における方針の決定やさまざまな判断をおこなっています。

売上高と売上総利益率



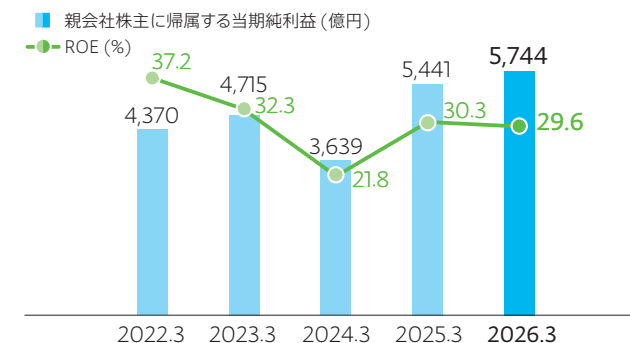
先端領域における活発な設備投資を背景とした好調な装置販売や、お客さまの工場稼働率上昇に伴う改造や保守用部品・サービスなどの売上増加により、売上高は2期連続で過去最高を更新

営業利益と営業利益率



営業利益率は前期と比べ減少したものの、翌期以降の大きな市場成長を見据え、半導体の技術革新を支える付加価値の高い製品を投入すべく、積極的な研究開発活動を推進

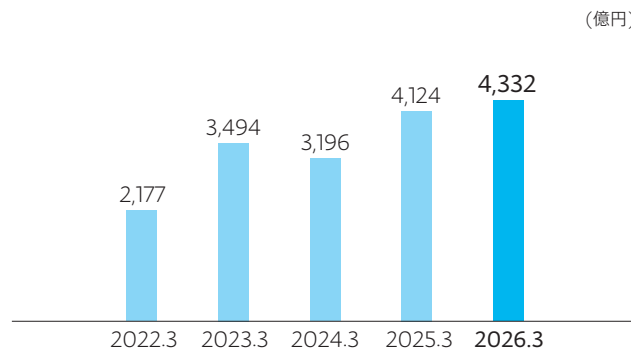
親会社株主に帰属する当期純利益とROE※1



過去最高となる当期純利益と適切なバランスシート・マネジメントにより、高水準のROEを維持

※1 ROE（自己資本利益率）＝親会社株主に帰属する当期純利益÷期首・期末平均自己資本×100

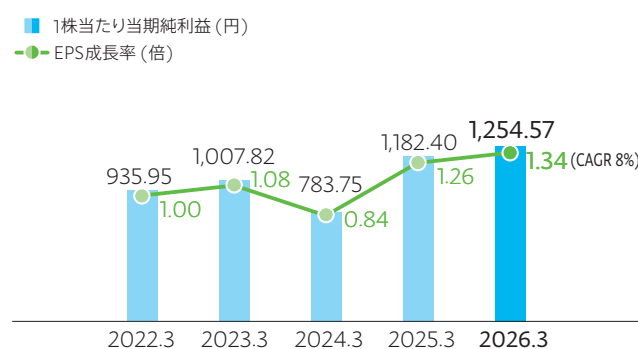
フリーキャッシュ・フロー※2



営業活動を通じて創出したキャッシュを原資として成長投資を継続。資本効率向上を図るため、政策保有株式も一部売却。フリーキャッシュ・フローは過去最高額

※2 フリーキャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー（定期預金および短期投資の増減を除く）

1株当たり当期純利益（EPS）※3とEPS成長率※4

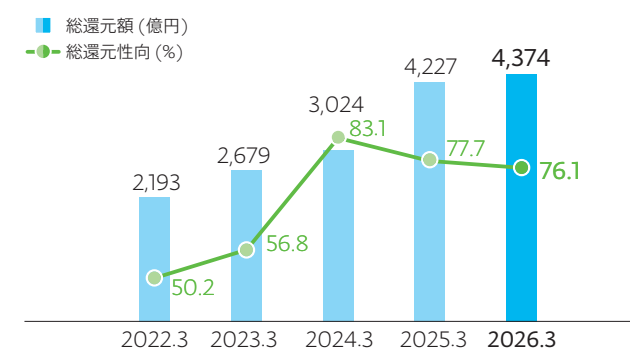


1株当たり当期純利益は増加傾向にあり、過去5年間の年平均成長率（CAGR）は8%

※3 2023年4月1日に実施した株式分割反映後の数値

※4 各期のEPS成長率は、2022年3月期を基準としたときの倍率を表示

総還元額と総還元性向



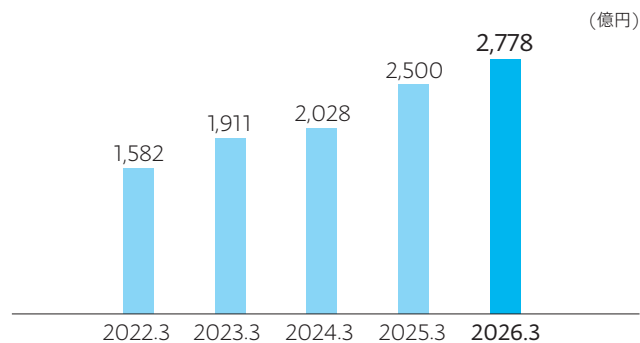
株主還元政策である配当性向50%※5に基づく配当金の支払いと自己株式の取得※6により総還元額は過去最高の4,374億円

※5 ただし、1株当たり年間配当金50円を下回らない。2期連続して当期利益を生みなかった場合は、配当金の見直しを検討

※6 機動的に実施を検討。なお、単元未満株式の買取りに要した金額を除いている

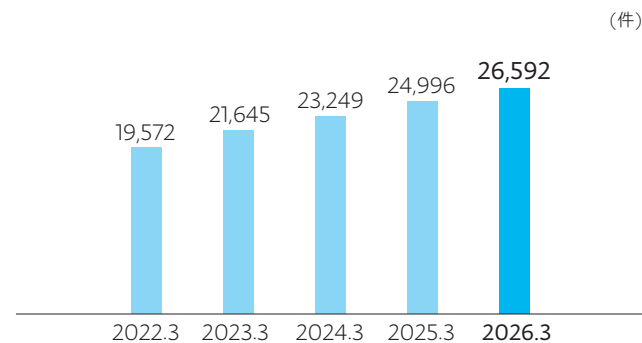
継続的な企業価値の向上に関する重要指標ハイライト

研究開発費



2026年3月期は2,778億円の研究開発投資を実施。中期経営計画の目標である1兆円以上に対して順調に進捗。さらなる成長投資として、2025年3月期からの5年間で1.5兆円以上の研究開発投資を推進

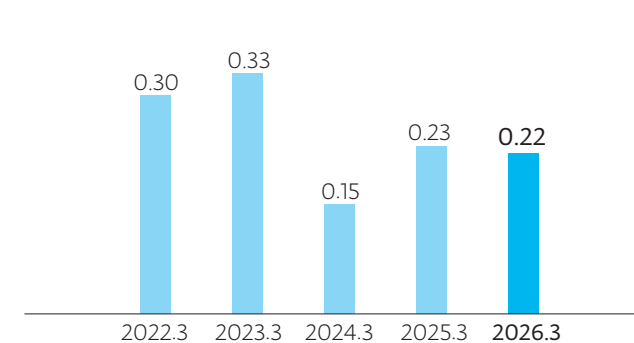
特許保有件数※1



2026年3月末時点の特許保有件数は26,592件であり、半導体製造装置業界でNo. 1。量と質の両面で競争力のある知的財産権ポートフォリオを構築し、知的財産領域における優位性をグローバルレベルで維持

※1 2022年3月期は社内データ、2023年3月期以降はLexisNexis® PatentSight+データに基づき作成

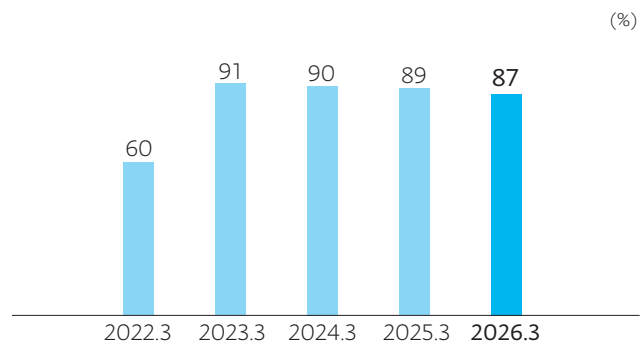
労働時間20万時間当たりの人身事故発生率 (TCIR※2)



2026年3月期は、安全キャンペーンの実施による安全意識の向上や装置安全設計に関する継続的な取り組みなどにより、0.22を達成。「Safety First」をスローガンに、中期経営計画の目標である0.10未満に向けたさまざまな活動を実施

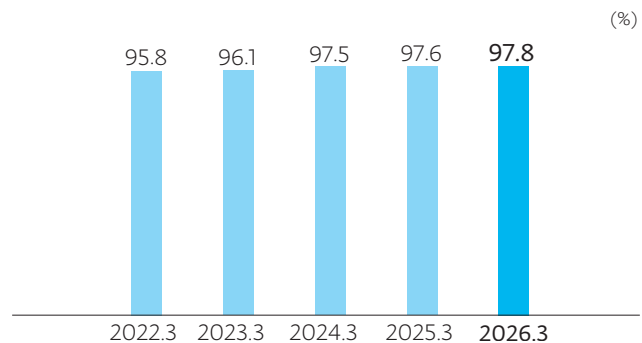
※2 TCIR: Total Case Incident Rate

事業所における再生可能エネルギー使用比率



2026年3月期は、再生可能エネルギーの使用比率が低いアジア地域における電力使用量の増加により、グローバルで87% (日本国内は100%)。2031年3月期までに使用比率100%の達成を目指し、再生可能エネルギーの導入を推進

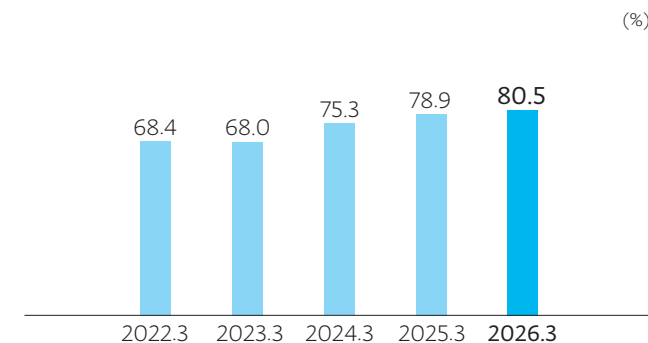
社員の定着率※3



2026年3月期はグローバルで97.8%の高い定着率を維持。社員が価値創出の源泉であるとの認識のもと、社員エンゲージメントのさらなる向上を目指して継続的かつ効果的に施策を展開

※3 離職率のデータを用いて算出

有給休暇取得率



2026年3月期はグローバルで80.5%の取得率。管理職には都度取得率を案内した上で、業務配分の調整など個人として取得しやすい環境づくりを推進